

# طراحی و شبیه‌سازی مدولاتور نوری سیلیکونی مبتنی بر ریز مشدد

## حلقه

حسین قاسمی<sup>۱</sup> محمدحسن یاوری<sup>۲</sup>

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه شاهد- تهران- ایران

[hossein.ghasemi@shahed.ac.ir](mailto:hossein.ghasemi@shahed.ac.ir)

۲- دکتری- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه شاهد- تهران- ایران

[mh.yavari@shahed.ac.ir](mailto:mh.yavari@shahed.ac.ir)

چکیده: در این مقاله یک نمونه‌ی مدولاتور نوری مخابراتی سیلیکونی مبتنی بر ریز مشدد حلقة طراحی شد. جهت دستیابی به سرعت مدولاسیون بالا بایستی ضریب کوپلینگ بهبود یابد. این موضوع از طریق تغییر ضریب کوپلینگ به ازاء طول‌های کوپلینگ مختلف و فواصل مختلف گپ بین موجبر باس و حلقة بررسی شد و طول کوپلینگ بهینه محاسبه شد. اثرات مختلفی مانند تغییر فاصله و میزان دوبینگ و تاثیر آن بر روی تغییرات ضریب شکست و جذب بررسی شد و درنتیجه ساختار بهینه جهت مدولاسیون مشدد حلقة بدست آمد. با بهبود پارامترهای مدولاتور و اضافه نمودن تغییرات ضریب کوپلینگ به مدولاتور حلقة، گین DC افزایش یافت و تابع تبدیل الکترواپتیکی پایدارتر شد. همچنین مقایسه‌ای نسبت به مدولاتورهای مشابه دیگران انجام شده و پهنانی باند تا یک مرتبه بهبود یافته است.

**واژه‌های کلیدی:** مدولاتور ریزمشدد حلقة، ضریب کوپلینگ عرضی، ضریب خودکوپل شدگی، طول کوپلینگ، پاسخ الکترواپتیکی

**نوع مقاله:** پژوهشی

DOI: [10.52547/jiaeee.19.2.47](https://doi.org/10.52547/jiaeee.19.2.47)

تاریخ ارسال مقاله: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

تاریخ پذیرش مشروط مقاله: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

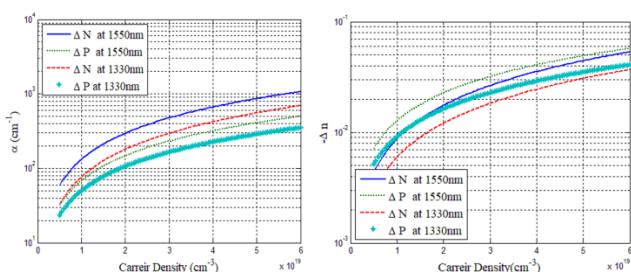
نام نویسنده‌ی مسئول: دکتر محمدحسن یاوری

نشانی نویسنده‌ی مسئول: ایران - تهران - دانشگاه شاهد - دانشکده‌ی فنی و مهندسی



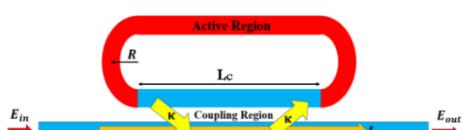
## ۱- مقدمه

که  $\Delta n_e$  و  $\Delta n_h$  تغییرات در حامل‌های آزاد الکترون و حفره است و باعث تغییرات در ضریب شکست می‌شود و  $\Delta \alpha_e$  و  $\Delta \alpha_h$  تغییرات جذب ناشی از به ترتیب تغییرات الکترون و حفره آزاد را نشان می‌دهد. تغییر ضریب شکست و ضریب جذب بر مبنای غلظت حامل‌ها در سیلیکون پاشندگی پلاسمای نامیده شد و با استفاده از رابطه (۱) می‌توان تغییر ضریب جذب و ضریب شکست را محاسبه نمود. تغییر در ضریب شکست و ضریب جذب با تغییر حامل‌ها طبق شکل (۱) ترسیم شده است.  $\Delta N$  و  $\Delta P$  به ترتیب دانسیته حامل‌های [cm<sup>-3</sup>] الکترون و حفره می‌باشد. از این نمودارها می‌توان پی‌برد که حفره‌ها تغییر ضریب شکست بزرگتری نسبت به الکترون‌ها دارند. اما تغییر کوچکتری در جذب دارند. بنابراین حفره‌ها نوعاً در طراحی مدولاتورها جهت حداقل کردن جذب و تغییر بیشتر در ضریب شکست استفاده می‌شوند.



شکل (۱): تغییر ضریب شکست (سمت چپ) و تغییر ضریب جذب (سمت راست) بر حسب دانسیته حامل

**۲- اصول عملکرد مدولاتور مشدد حلقه (RRM)**  
ساختار مدولاتور مشدد میکرو حلقه همان فیلتر مشدد حلقه با طول فعال داخل حلقه است. شکل (۲) شماتیکی از RRM تک باس را نشان می‌دهد. سیگنال خروجی مدوله شده در پورت ثرو<sup>+</sup> قرار می‌گیرد. در ساختار دو پورت آن، پورت دراپ جهت کنترل عملکرد صحیح حلقه در انحرافات دمایی و انحرافات ساخت است. نحوه عمل به این شکل است که ناحیه فعال درون حلقه قرار می‌گیرد با اعمال ولتاژ  $V_m$  به طول  $L_{active} = 2\pi R + Lc$ , طول موج تشديد جابجا می‌شود.



شکل (۲): شماتیک از RRM تک - باس؛  $Lc$  و  $R$  به ترتیب طول کوپلینگ، ضریب کوپلینگ عرضی، ضریب خودکوپل شدگی و ساع حلقه هستند

مدولاتورهای حلقه سیلیکون معمولاً از تزریق حامل‌ها در دیودهای PIN و یا تخلیه حامل‌ها در دیودهای مدولاتور PN ساخته می‌شوند. تخلیه حامل از پیچیدگی کم و سرعت بالا برخوردار هستند

استفاده از تکنولوژی سیلیکون فوتونیک به دلیل هزینه‌های ساخت کم، بهبود عملکرد ناشی از ادغام فوتونیک با الکترونیک و سازگاری با موفق‌ترین تکنولوژی برای تولید قطعات الکترونیک نوری مبتنی بر تکنولوژی CMOS در حال گسترش است. در بین قطعات الکترونیک نوری مدولاتورهای نوری سیلیکونی قدمتی به اندازه سیلیکون فوتونیک دارند و یکی از اولین دیوایس‌های مورد مطالعه، پس از کار اولیه بر روی تکنولوژی موج‌برهای نوری پایه بوده است. مدولاتور نوری ابزاری است برای مدوله کردن نوری که در فضای آزاد یا در موج‌بر نوری منتشر می‌شود. یک منبع نوری می‌تواند به صورت مستقیم یا خارجی مدوله شود. مدولاسیون خارجی مزایای متعددی را نسبت به مدولاسیون مستقیم دارد. منبع نوری در این روش نسبتاً ارزان است و کارکرد آن با مدولاسیون مستقیم محدود نمی‌شود، سرعت مدولاسیون در آن بالاتر می‌باشد و همچنین مدولاسیون مستقیم فاز امکان پذیر است [۱].

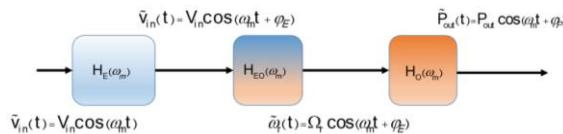
مدولاتورهای تمام سیلیکونی بر مبنای اثر پاشندگی پلاسمای انتصال‌های pn که با بایاس معکوس کار می‌کنند، به علت سازگاری با فرایندهای ساخت CMOS ترجیح داده می‌شوند [۲]. اولین مدولاتور پاشندگی پلاسمای مبتنی بر سیلیکون توسط سورف و بنت [۳] پیشنهاد شد. از آن به بعد روش‌های مختلفی جهت بهبود عملکرد آن استفاده شده است [۴].

در این تحقیق ساختار بهینه جهت مدولاسیون در مشدد حلقه بدست آمده است. این موضوع از طریق تغییر ضریب کوپلینگ به ازاء طول‌های کوپلینگ مختلف و فواصل مختلف گپ بین موج‌بر باس و حلقه و همچنین اثرات مختلفی مانند تغییر فاصله و میزان دوپینگ، اثرات کوچک سازی ساختار PN و تاثیر آن بر روی تغییرات ضریب شکست و جذب بدست آمده است. پاسخ الکترواپتیکی مدولاتور محاسبه شده است. همچنین مقایسه‌ای نسبت به مدولاتورهای مشابه دیگران انجام شده است. کلیه شبیه سازی‌ها و نمودارهای مربوط به ترتیب در نرم‌افزارهای لومریکال و متلب انجام شده است. در ذیل مبانی نظری مرتبط با کارهای انجام شده آورده شده است.

## ۲- مبانی نظری

آقایان سورف و بنت [۵] تغییرات در هر دو ضریب شکست و جذب را اندازه گیری کرده و رابطه (۱) را برای ارزیابی تغییرات در غلظت‌های حامل در سیلیکون در طول موج ۱/۵۵ میکرومتر بدست آورده‌اند،

$$\begin{aligned}\Delta n &= \Delta n_e + \Delta n_h \\ &= [5.4 \times 10^{-22} \times \Delta N^{1.01} + 1.53 \times 10^{-18} \times \Delta P^{0.838}] \\ \Delta \alpha &= \Delta \alpha_e + \Delta \alpha_h \\ &= 8.88 \times 10^{-21} \times \Delta N^{1.67} + 5.84 \times 10^{-20} \times \Delta P^{1.109}\end{aligned}\quad (1)$$



شکل (۳): تقسیم بندی دیاگرامی توابع تبدیل مدولاتور حلقه پاسخ الکتریکی مدولاتور حلقه توسط قطب غالب آن به صورت فیلتر پایابین گذار به صورت  $H_E(\omega) = 1 + j\omega_m R_{eq} C_{eq}$  مدل می‌شود.

ولتاژ AC فیلتر شده در محل اتصال PN (شکل (۳))،  $\tilde{v}_j(t)$  است.

و  $H_{EO}$  عبارت است از،

$$H_{EO} = \left( -\frac{\omega_r}{n_g} \frac{\partial n_{eff}}{\partial V} \Big|_{DC} + j \frac{\partial \left( \frac{1}{\tau} \right)}{\partial V} \Big|_{bc} \right). \quad (\Delta)$$

که  $n_g$  ضریب شکست گروه،  $n_{eff}$  ضریب شکست موثر و  $\tau$  ثابت زمانی دامنه کاهیده است.  $H_E$  و  $H_{EO}$  به ترتیب توابع تبدیل الکتریکی و الکتروپاتئیک هستند که در محاسبه تابع تبدیل سوم  $H_O$ ، از تئوری مدل کوپل شده رفتار نوری ریز مشدد حلقه با استفاده از معادلات زیر مدل سازی می‌شود.

$$\frac{da}{dt} = \left( j\omega_r - \frac{1}{\tau} \right) a - j\mu S_i , \quad (8)$$

که  $a$  دامنه انرژی‌ای است که در داخل حلقه گردش می‌کند و  $\tau_e = \tau_l + 1/\tau_1$  است که  $\tau_l$  و  $\tau_e$  به ترتیب ثوابت زمانی افت دامنه به دلیل اتفاقات ذاتی درون کواک و به دلیل کوپلینگ حلقه به موجب باس است. با معادلات نرخ بالا توان خروجی و در نهایت تابع تبدیل مدولاتور حلقه به صورت زیر بدست می‌آید،

$$H_t(\omega_m) = \frac{2\mu^2 P_m}{\frac{1}{\tau^2} + \Delta\omega^2} \left[ -\frac{\frac{\omega_r}{n_g} \hat{C} n_{eff}}{\frac{\partial V}{\partial \hat{C}}} \Big|_{DC} \right] \left( tg(\phi_{H_{EO}}) \left( \frac{1}{\tau_l} - \frac{1}{\tau_e} \right) - \Delta\omega \right) \\ + \frac{\frac{2\Delta\omega}{\tau_l} + tg(\phi_{H_{EO}}) \left( \Delta\omega^2 - \frac{1}{\tau} \left( \frac{1}{\tau_l} - \frac{1}{\tau_e} \right) \right)}{j\omega_m - \frac{tg(\phi_{H_{EO}}) \left( \frac{1}{\tau_l} - \frac{1}{\tau_e} \right) - \Delta\omega}{-\omega_m^2 + \frac{2}{\tau} (j\omega_m) + \Delta\omega^2 + \frac{1}{\tau_e^2}}} \quad (V)$$

جهت محاسبه مقادیر  $R_{eq}$  و  $C_{eq}$  از روش مقاله [۹] استفاده شده است.

از ضرایب کوپلینگ استخراج شده و ضریب اتلاف توان وابسته به ولتاژ،  $\tau_l$  و  $\tau_e$  محاسبه شده است [۸].

$$\tau_e = \frac{2L_n}{v_g K^2}, \tau_l = \frac{2}{v_g \alpha(V)}. \quad (\lambda)$$

که  $v_g$  سرعت گروه و  $K$  ضریب کوپلینگ  $(\sqrt{1 - t^2})$  و  $L_{rt}$  طول چرخش حلقه هستند. در صورت در نظر گرفتن تغییرات کوپلینگ با ولتاژ از ترکیب روابط (۵) و (۸) به رابطه‌ی زیر خواهیم رسید،

$$H_{EO} = -\frac{\omega_r}{r} \frac{\partial n_{eff}}{\partial V} \Big|_{V=DC} + j \left( \frac{v_g}{2} \frac{\partial \alpha}{\partial v} + \frac{v_g}{L} \frac{\partial \kappa}{\partial v} \right) \Big|_{V=DC} \quad (4)$$

با استفاده از رابطه (۹) مقدار  $\text{tg}(\Phi_{\text{HO}})$  به صورت زیر تغییر خواهد کرد،

اما ضریب کارایی مدولاسیون<sup>(۵)</sup> (ME) در آن کم است. که منجر به ER و IL کم می شود. ضریب شکست موثر و ضریب جذب با ولتاژ تغییر می کند و باعث انتقال فاز (V)  $\phi$  و تضعیف میدان در یک دور پیمودن در حلقه می شود. این بیان در روابط زیر داده شده است،

$$\alpha(V, \lambda) = \frac{\alpha_o}{2} Lc + \Delta\alpha(V).L_{active} \quad (7)$$

که  $R$  شعاع حلقه،  $n_{eff}$  ضریب شکست موثر و  $\lambda$  طول موج است.

مد اپتیکی در  $(V_m, \Delta n_{\text{eff}})$  تغییرات ضریب شکست با ولتاژ به کار گرفته شده در اتصال ناچیه فعال،  $\alpha_0$  ضریب جذب شدت و  $(\Delta\alpha, V_m)$  تغییر ضریب جذب با ولتاژ اعمالی روی ناچیه فعال است. در نرم افزار دیوایس لومریکال، توزیع فضایی حامل‌های بار به‌شکل تابعی از ولتاژ FDE می‌باشد. بدست آن خروجی به‌شکل فایل متلب به حلگر نرم افزار مدل سلوشن بارگذاری می‌شود و تغییرات ضریب شکست به‌شکل تابعی از ولتاژ بدست خواهد آمد.

## ۲- نحوه محاسبه ضریب کویلینگ

مفهوم مدهای کوپل شده در الکترومغناطیس به اوایل دهه ۱۹۵۰ بر می‌گردد. کاربرد آن ابتدا به مایکروویوها محدود بود و به تدریج از طریق مشارکت بسیاری از محققان توسعه یافت. در سال ۱۹۵۴، پیرس تئوری مد کوپل شده را برای تجزیه و تحلیل لوله‌های انتشاری موج مایکروویو به کاربرد [۶]. نظریه مدهای کوپل شده در رفتار تقویت کننده‌های پارامتری، نوسانگرهای فرکانس به کار می‌رود. ضریب کوپلینگ با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود [۷]،

$$\kappa_{pq} = \frac{\omega \epsilon_0 \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (N^2 - N_q^2) \hat{E}_p^* \hat{E}_q dx dy}{\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} u_z [E_p \times \hat{H}_p]^* + [\hat{E}_p \times \hat{H}_p^*] dx dy} \quad (3)$$

بهطور خلاصه ضریب کوپلینگ، نسبتی از توان مد پایه TE در یک موجبر مستقیم جفت شده به مد پایه TE موجبر منحنی است. مقدار آن را می‌توان با طول کوپلینگ و یا فاصله‌ی بین موجبر بایس و مشدد حلقه کنترل کرد. در نرم افزار لومربیکال نسبت خروجی‌های هر یک از پورت‌های مربوطه پارامترهای مختلف S را به ما می‌دهد. و از روی آن ضریب کوپلینگ استخراج خواهد شد.

## ۱-۱- نحوه محاسبه پهنای باند مدولاتور

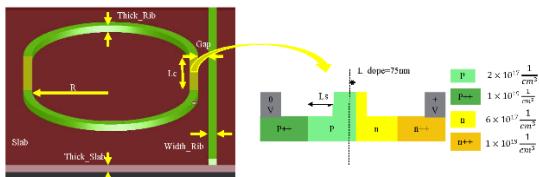
جهت محاسبه پنهانی باند مدولاتور حلقه از روش استفاده شده در مرجع [۸] به صورت تعیین تابع تبدیل استفاده شده است،

$$H_t(\omega_m) = \frac{\tilde{P}_{out}}{V_{in}} \quad (4)$$

برای به دست آوردن  $H_t(\omega_m)$ ، پاسخ مدولاتور حلقه به ولتاژ را انداز سیگنال کوچک را می‌توان به سه بخش پاسخ‌های الکتریکی  $(H_E(\omega_m), H_{EO}(\omega_m), H_0(\omega_m))$  و اپتیکی  $(H_0(\omega_m))$  مطابق شکار (۳) تقریب کرد.

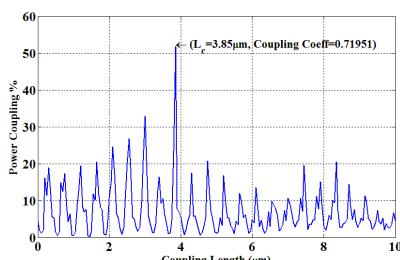
با استفاده از شکل (۴ الف) طول کوپلینگ  $8/45$  میکرومتر انتخاب شد. با تغییر فاصله گپ بین باس و حلقه، نمودار تغییرات کوپلینگ به شکل (۴ ب) بدست آمد. از این نمودار پیداست که با افزایش گپ در حالت کلی نمودار روندی نرولی دارد.

نمودار بالا نشان می‌دهد که انتخاب فاصله گپ  $30$  نانومتر مطابق جدول (۱) درست بوده است. هنگامی که دوپینگ PN مطابق شکل (۵) به قسمت LC حلقه اعمال شود، تغییر ضریب شکست بین موجبر باس و موجبر حلقه بیشتر خواهد شد و در نتیجه طول کوپلینگ به حدود یک میکرومتر کاهش خواهد یافت. مزیت اینگونه اعمال چگالی اختلاف بیشتر ضرایب شکست و در نتیجه کاهش طول کوپلینگ است.



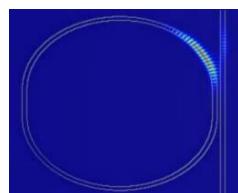
شکل (۵): شماتیکی از مدولاتور ریزمشدد طراحی شده که دانسیته‌ی حامل‌ها به بخش LC روبروی باس مدولاتور اضافه شده است

مشدد حلقه مرجع [۸] با تمامی مشخصات آن در لومریکال شبیه سازی شد و بر اساس نمودار بدست آمده از تغییرات ضریب کوپلینگ با طول LC مطابق شکل (۶) در صورتی که طول کوپلینگ را به  $3/85$  میکرومتر افزایش داده بودند، ضریب کوپلینگ تا حدود چهار برابر افزایش و بالتع پهنه‌ای باند بهبود می‌یافتد. از این شکل و شکل (۴ الف) پیداست که ضریب کوپلینگ بر حسب طول کوپلینگ خاصیت نوسانی دارد.



شکل (۶): محاسبه درصد ضریب توان کوپلینگ بر حسب طول کوپلینگ در مشدد حلقه مرجع [۸]

میزان توان کوپل شده از موجبر باس به مشدد حلقه طراحی شده در نرم‌افزار Mode Solution به طور لحظه‌ای در شکل (۷) آورده شده است. میزان کوپل شدگی باریکه به حلقة مدولاتور طراحی شده تا حد زیادی افزایش داشته است.



شکل (۷): تصویر لحظه‌ای از توان کوپل شده به رینگ

$$\operatorname{tg}\left(\phi_{\text{HEO}}\right) = -\frac{\frac{v_g}{2} \frac{\partial a}{\partial v} + \frac{v_g}{L_n} \frac{\partial \kappa}{\partial v}}{\frac{\omega_r}{n_g} \frac{\partial n_{\text{eff}}}{\partial v}} \quad (10)$$

با جایگذاری رابطه (۱۰) در رابطه (۷) تابع تبدیل جدید بدست خواهد آمد.

### ۳- شبیه‌سازی

در این کار اثرات مختلفی مانند تغییر فاصله دوپینگ، تغییر دوپینگ، اثرات کوچک سازی دیوایس بررسی شد به این صورت که با بدست آمدن مقادیر بهینه هر پارامتر مقدار بهینه پارامتر بعدی محاسبه و موجبر بهینه طراحی شد. در ادامه تغییر ضریب کوپلینگ به ازاء طول‌های کوپلینگ مختلف انجام و طول کوپلینگ بهینه محاسبه شد سپس توان کوپلینگ به ازاء فواصل گپ مختلف بین موجبر باس و حلقه محاسبه و فاصله بهینه بدست آمد و از مقادیر بدست آمده مدولاتور ریز مشدد حلقه طراحی شد. در ادامه تغییرات توان کوپلینگ نسبت به ولتاژ در ریز مشدد حلقه محاسبه و با استفاده از فرمول استخراج شده پاسخ الکتروپاتیکی مدولاتور محاسبه شد. در ذیل به ترتیب مطالب ذکر شده بررسی شده است.

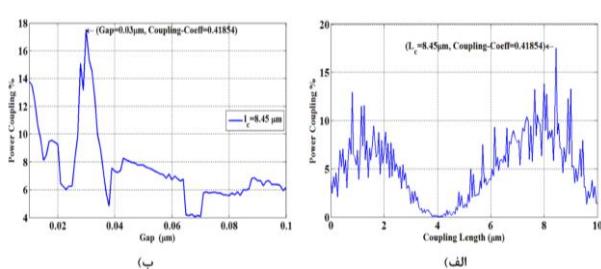
#### ۳-۱- محاسبات مربوط به ضریب کوپلینگ

ابتدا ریز مشدد حلقه با توجه به پارامترهای شکل (۵) و مشخصات جدول (۱) طراحی شد که طول کوپلینگ LC صفر در نظر گرفته شد.

جدول (۱): مشخصات مدولاتور حلقه طراحی شده اولیه

R	Gap	Thick_slab	Thick_Rib	Width_Rib
$5\mu\text{m}$	$0.03\mu\text{m}$	$0.07\mu\text{m}$	$0.12\mu\text{m}$	$0.43\mu\text{m}$

نمودار ضریب کوپلینگ بر حسب طول کوپلینگ LC در طول موج ۱.۵۴۴ میکرومتر در مورد موجبر طراحی شده با روش ذکر شده در بخش پیش به شکل (۴ الف) محاسبه شده است. همان‌طور که از نمودار پیداست هنگامی که طول کوپلینگ به  $8/4$  میکرومتر افزایش پیدا کند، ضریب توان کوپلینگ تا حدود چهار برابر افزایش می‌یابد.



شکل (۴): درصد ضریب توان کوپلینگ بر حسب (الف) طول کوپلینگ و (ب) فاصله گپ در مشدد حلقه طراحی شده مطابق جدول (۱).

در نهایت با استفاده از نتایج بدست آمده مدولاتور مطابق جدول (۲) طراحی شد.

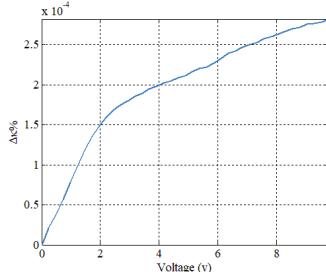
جدول (۲): مشخصات بهینه بدست آمده مدولاتور حلقه طراحی

شده

Lc	L_dope	Ls	P_doping (cm <sup>-3</sup> )	N_doping (cm <sup>-3</sup> )	Gap
8.45μm	75nm	0.01μm	2 × 10 <sup>17</sup>	6 × 10 <sup>17</sup>	30nm

### ۴-۳- تغییرات توان کوپلینگ نسبت به ولتاژ

با توجه به نتایج بدست آمده از بخش قبل طراحی ریز مشدد حلقه با مشخصات ذکر شده در جداول (۱) و (۲) در نرم افزار FDTD انجام شد. در این طراحی جهت بررسی تغییرات ضریب کوپلینگ با ولتاژ، دانسیته‌ی حامل‌ها بدست آمده از نرم افزار Device به بخش Lc مدولاتور اضافه گردید که شمایی از آن در شکل (۵) آورده شده است. نمودار درصد تغییرات ضریب کوپلینگ بر حسب ولتاژ به شکل (۱۱) محاسبه شد.



شکل (۱۱): درصد تغییرات ضریب کوپلینگ بر حسب ولتاژ؛ دانسیته‌ی حامل‌های بدست آمده از نرم افزار Device به بخش حلقه مدولاتور اضافه شده است

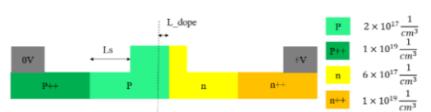
همان‌طور که از شکل مشخص است با افزایش ولتاژ تغییرات ضریب کوپلینگ افزایش خواهد یافت. از نتایج این نمودارها در بخش بعد جهت محاسبه پهنانی باند استفاده خواهد شد.

### ۵-۳- محاسبات پهنانی باند مدولاتور

در مرجع [۸] طراحی مدولاتور انجام شده و پاسخ الکتروپاتیک مدولاتور حلقه را در عدم جفت‌شدن مختلف لیزری شبیه‌سازی کرده است. نتایج اندازه گیری در شکل (۱۲) نشان داده شده است. نتایج حاصل از سه عدم جفت‌شدن مختلف فرکانس لیزر و فرکانس رزونانس از نشان داده شده است. این شکل‌ها به طور واضح پاسخ فرکانس وابسته به عدم جفت‌شدن مختلف مدولاتور حلقه را نشان می‌دهد. در این مرجع پهنانی باند حدود 8.7 GHz بدست آمده است.

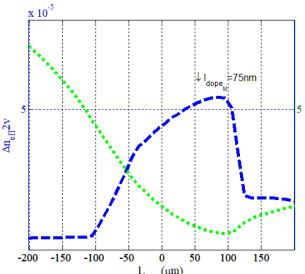
### ۶-۲- بررسی اثرات تغییر فاصله دوپینگ

جهت بررسی اثرات تغییر فاصله دوپینگ P نسبت به دوپینگ N از مرکز ریب (L\_dope) ابتدا موجبر با مشخصات شکل (۸) و جدول (۱) طراحی شد.



شکل (۸): شمایی از اعمال دوپینگ به موجبر

نمودارهای تغییرات ضریب شکست و اتلاف به شکل (۹) بدست آمد.



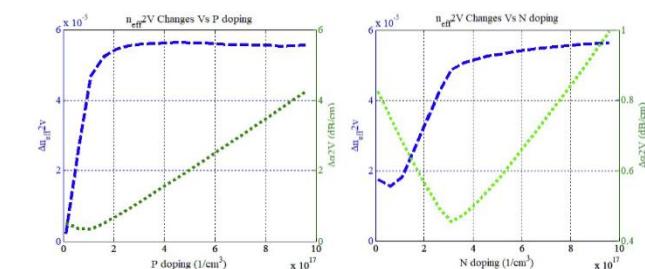
شکل (۹): نمودار تغییرات ضریب شکست (محور سمت چپ) و ضریب جذب (محور سمت راست) بر حسب L\_dope در ولتاژ کاری

۲۷

همان‌طور که از نمودارها پیداست تغییرات ضریب شکست موثر در مورد دوپینگ P با ازدیاد فاصله نسبت به مرکز ریب افزایش و پس از آن و با افزایش فاصله نسبت به مرکز ریب در جهت منفی به علت افزایش جذب بشدت کاهش می‌یابد یعنی در مورد طراحی PN بایستی دوپینگ P از مرکز ریب بیشتر انتخاب شود تا میزان تغییرات ضریب شکست بیشتر شود.

### ۶-۳- بررسی اثرات تغییرات میزان دوپینگ

اثرات تغییر دوپینگ P و N با طراحی جدول (۱) و شکل (۸) با L\_dope=75nm انجام شد. نمودارهای تغییرات ضریب شکست و ضریب جذب به شکل (۱۰) بدست آمد. از این نمودارها پیداست که افزایش دوپینگ P و N تا مقدار مشخصی روند افزایشی داشته و این به علت افزایش بهترین ترتیب میزان حفره‌ها و الکترون‌هاست و از حدی بیشتر به علت اثرات پراکندگی اتفاقات افزایش می‌یابد.



شکل (۱۰): نمودار تغییرات ضریب شکست (محور سمت چپ) و ضریب جذب (محور سمت راست) بر حسب دوپینگ‌های مختلف P و N در ولتاژ کاری

۲۷

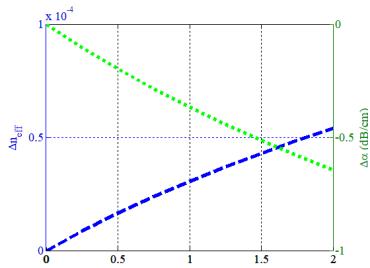


از مقایسه این نمودار و نتایج بدست آمده در این مرجع [۸] مطابق شکل (۱۲) نشان می‌دهد که در توازن خوبی با هم هستند. همچنین از این روش جهت محاسبه پاسخ الکتروپاتیکی مدولاتور مرجع [۱۰] نیز استفاده شد که در توازن با نتایج این مرجع بوده است. در طراحی انجام شده در این کار مطابق جداول (۱) و (۲) به طور مشابه پاسخ الکتروپاتیکی مدولاتور محاسبه شد که در ذیل آورده شده است.

طراحی مدولاتور به شکل

جدول (۲) با  $Lc=0$  انجام شد. با استفاده از نمودار شکل (۱۵)

بدست آمده از نرم افزار Mode Solution لومریکال تغییرات ضریب شکست و ضریب جذب بر حسب ولتاژ به ترتیب  $\frac{1}{v} \times 10^{-5}$  و  $\frac{1}{vm} \times 1/07 - 1/07$  در ولتاژ کاری ۲ ولت بدست آمد.

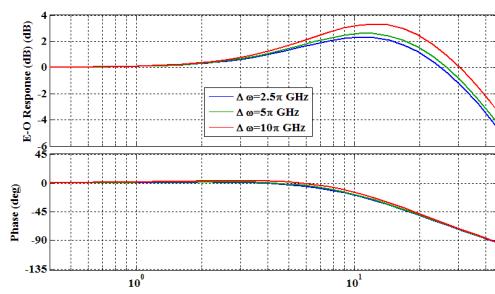


شکل (۱۵): نمودار تغییرات ضریب شکست (محور سمت چپ) و ضریب جذب (محور سمت راست) بر حسب ولتاژ بایاس معکوس

با استفاده از پارامترهای بدست آمده از شبیه‌سازی (جدول (۳)) و رابطه (۷)، پاسخ الکتروپاتیکی مدولاتور در نرم افزار متبلا به شکل (۱۶) بدست آمد. مقدار  $G_{DC} = 0.27$  حاصل شد.

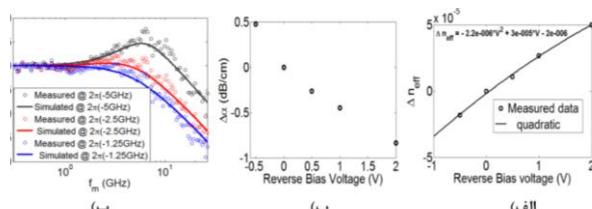
جدول (۳): پارامترهای بدست آمده از شبیه‌سازی

$\alpha(\frac{1}{m})$	$\frac{\partial \alpha}{\partial V}(\frac{1}{vm})$	$\frac{\partial n_{eff}}{\partial V}$	$V_g(\frac{m}{s})$	$n_g$
547	-1.07	$2.63 \times 10^{-5}$	$6.5 \times 10^7$	3.42



شکل (۱۶): پاسخ الکتروپاتیکی بر حسب فرکانس مدولاسیون در  $\Delta\omega$  برابر با  $5\pi$  GHz،  $2.5\pi$  GHz و  $10\pi$  GHz شبیه‌سازی شده که نرمالیزه شده است

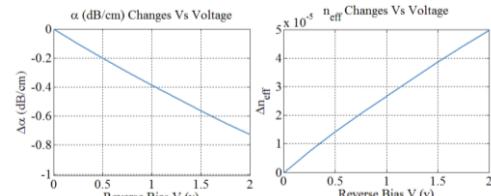
همان‌طور که از نمودارها مشخص است پهنای باند در این طراحی تقریباً ۵ برابر افزایش یافته  $f_{3dB} = 41.5$  GHz و حساسیت مدولاتور



شکل (۱۲): نمودارهای اندازه گیری شده (الف)،  $\Delta n_{eff}$ ، (ب)،  $\Delta \alpha$  بر حسب ولتاژ و (پ) پاسخ الکتروپاتیکی بر حسب فرکانس مدولاسیون در  $\Delta\omega$  برابر با  $10\pi$  GHz و  $5\pi$  GHz و  $2.5\pi$  GHz شبیه‌سازی شده و اندازه گیری شده که نرمالیزه شده است [۸]

طراحی مربوط به این مرجع در نرم افزار Device انجام شد و چگالی حامل‌ها بر حسب مکان در ولتاژهای مختلف به صورت فایل متلب به نرم افزار Mode Solution اضافه گردید و تغییرات ضریب جذب و ضریب شکست بر حسب ولتاژ به صورت نمودارهای شکل (۱۳) بدست آمد.

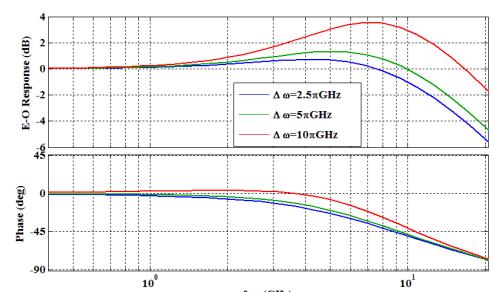
با استفاده از نمودار تغییرات ضریب جذب و ضریب شکست بر حسب ولتاژ بدست آمده از نرم افزار Mode Solution لومریکال (مطابق شکل (۱۳)) به ترتیب این مقادیر  $-2.8 \times 10^8 \frac{1}{sv}$  و  $2.35 \times 10^{-5} \frac{1}{v}$  بدست آمد.



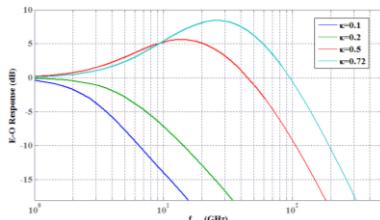
شکل (۱۳): نمودارهای بدست آمده با استفاده از نرم افزار لومریکال (چپ)  $\Delta \alpha$  و (راست)  $\Delta n_{eff}$  بر حسب ولتاژ

که با نمودارهای تغییرات ضریب شکست و ضریب جذب اندازه-گیری شده در مرجع [۸] (شکل (۱۲)) توازن خوبی دارند.

با استفاده از داده‌های بدست آمده از شبیه‌سازی و نتایج شکل (۱۲) و رابطه (۷) نمودار پاسخ الکتروپاتیکی این مدولاتور به شکل (۱۴) بدست آمد.



شکل (۱۴): پاسخ الکتروپاتیکی بر حسب فرکانس مدولاسیون در  $\Delta\omega$  برابر با  $5\pi$  GHz،  $2.5\pi$  GHz و  $10\pi$  GHz شبیه‌سازی شده که نرمالیزه شده است



شکل (۱۹): پاسخ الکترواپتیکی بر حسب فرکانس مدولاسیون در  $\Delta\omega = 2.5\pi \text{ GHz}$ ، بر حسب ضرایب کوپلینگ مختلف

#### ۴- نتیجه‌گیری

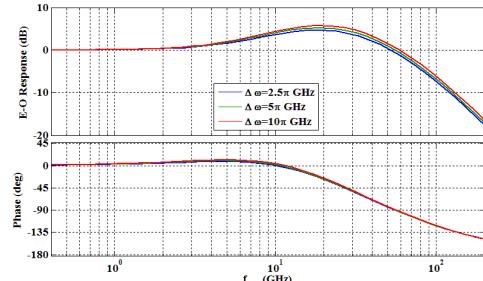
سرعت مدولاسیون بالا اهمیت ویژه‌ای در اتصالات نوری که در آن نرخ داده‌ها بالا است، دارد. جهت دستیابی به این موضوع در مدولاتورهای ریز مشدد حلقه بایستی کوپلینگ بهبود یابد. با ارائه روشی این موضوع از طریق تغییر ضریب کوپلینگ به ازاء طول‌های کوپلینگ مختلف بررسی شد و طول کوپلینگ بهینه محاسبه شد. با شبیه‌سازی توزیع ناخالصی و توزیع حامل در یک مدولاتور فاز ناحیه تخلیه در یک ساختار PN میزان تغییرات ضریب شکست و جذب محاسبه گردید. ساختارهای مختلفی مانند تغییر فاصله دوپینگ، تغییر دوپینگ و اثرات کوچک سازی دیوایس محاسبه شد که منجر به طراحی مدولاتور موثر، موجبر بهینه و سپس مدولاتور حلقه بهینه در نرم افزار لومریکال بدست آمد و برای اولین بار تغییرات ضریب کوپلینگ به فرمول استخراج شده محاسبه پهنانی باند اضافه گردید. در طراحی جدید پهنانی باند تا حدود یک مرتبه افزایش یافت با بهبود این فرمول و اضافه نمودن تغییرات ضریب کوپلینگ بر حسب ولتاژ به مدولاتور حلقه، گین DC افزایش یافت و تابع تبدیل الکترواپتیکی پایدارتر شد. پهنانی باند بالا مستقیماً فاکتور Q اپتیکی را کاهش می‌دهد که در اینجا مصالحه‌ای<sup>۷</sup> رخ می‌دهد.

#### ۵- مراجع

- [1] G. T Reed, G. M. Mashanovich, F. Y. Grades and D. J. Thomson, "Silicon optical modulators", *Nature photonics*, Vol. 4, 2010.
- [2] K. Giewont, K. Nummy, F. A. Anderson, J. Ayala, T. Barwicz, S. Member, S. Member, Y. Bian, K. K. Dezfulian, D. M. Gill, T. Houghton, S. Hu, B. Peng, M. Rakowski, S. R. Iii, J. C. Rosenberg, A. Sahin, I. Stobert, and A. Stricker, "300-mm Monolithic Silicon Photonics Foundry Technology," *IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron.* 25(5), 8200611, 2019.
- [3] R. A. Soref and B. R. Bennett, "Kramers-Kronig analysis of electro-optical switching in silicon", *SPIE Vol. 704 Integrated Optical Circuit Engineering IV*, 1986.
- [4] Y. Ma, Z. Xuan, Y. Liu, R. Ding, Y. Li, A. Lim, G. Q. Lo, T. Baehr-Jones and M. Hochberg, "Silicon Microring Based Modulator and Filter for High Speed Transmitters at 1310 nm", *IEEE*, 14547272, 2014.
- [5] R. A. Soref, B. R. Bennett, "Electrooptical effects in silicon" *IEEE J. Quantum Electron.* QE-23, PP.123-129, 1987.

به عدم جفت شدگی لیزر بسیار کاهش یافته است. در صورتی که  $Lc$  را مطابق

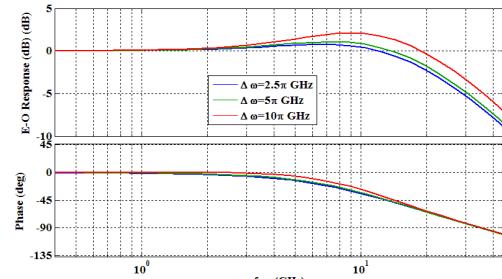
جدول (۲) و شکل (۴) یعنی  $8/45$  میکرومتر در نظر بگیریم پاسخ الکترواپتیکی مدولاتور به شکل (۱۷) بدست می‌آید.



شکل (۱۷): پاسخ الکترواپتیکی بر حسب فرکانس مدولاسیون در  $\Delta\omega$  برابر با  $2.5\pi \text{ GHz}$ ،  $5\pi \text{ GHz}$  و  $10\pi \text{ GHz}$  شبیه‌سازی شده که

$$\text{نرماییزه شده است با } Lc=8.45\mu\text{m}$$

در این حالت پهنانی باند دوبرابر شده است. اگر تغییرات  $\kappa$  نسبت به ولتاژ در نظر گرفته و طراحی مدولاتور انجام شود. مطابق نتایج بدست آمده از شکل (۱۱)،  $\frac{\partial\kappa}{\partial V} = 8 \times 10^{-5} \frac{1}{V}$  و  $\kappa = 0.26$  مقداری جدول (۳) که از نرم افزار لومریکال استخراج شده است. با جایگذاری رابطه (۱۰) در رابطه (۷) نمودار پاسخ الکترواپتیکی در این حالت به شکل (۱۸) بدست آمده است.



شکل (۱۸): پاسخ الکترواپتیکی بر حسب فرکانس مدولاسیون در  $\Delta\omega$  برابر با  $2.5\pi \text{ GHz}$ ،  $5\pi \text{ GHz}$  و  $10\pi \text{ GHz}$  حالتی که تغییرات کوپلینگ نسبت به ولتاژ اعمال شده است

همان‌طور که از نمودار پیوست تغییرات ضریب کوپلینگ با ولتاژ تاثیر چندانی بر پهنانی باند ندارد و تاثیر مستقیم آن بر روی فاز تابع تبدیل الکترواپتیکی است ولی گین DC را دوبرابر می‌کند  $0/49$  و با کاهش مقدار صفر تابع تبدیل به پایداری سیستم کمک خواهد کرد. همچنین در صورت تغییر ضریب کوپلینگ پهنانی باند مدولاتور به شکل (۱۹) تغییر خواهد کرد و همان‌طور که در بخش پیش ذکر شد در صورتی که مرجع [۸] طول کوپلینگ را  $3/85$  میکرومتر انتخاب کرده بودند. ضریب کوپلینگ تقریباً  $0/72$  می‌شد در اینصورت پهنانی باند مطابق نمودار شکل (۱۹) حداقل تا یک مرتبه بهبود می‌یافت و هم مرتبه موارد مشابه با طراحی‌های پیچیده‌تر شانه‌ای خواهد شد که فرآیند ساخت در آن سخت‌تر است [۱۱].



[6] H. A. HAUS and W. Huang, "Coupled-Mode Theory", Proceedings of IEEE, VOL 19, NO 10, 1991.

[7] Katsunary Okamoto, "Fundamentals of Optical Waveguides", Ch.4, PP.160-163.

[8] Samira Karimelahi, "Silicon ring modulators for high-speed optical interconnects", thesis for the degree of Doctor of Philosophy, Department of Electrical and Computer Engineering University of Toronto, 2016.

[9] R. Dube-Demers, J. St-Yves, A. Bois, Q. Zhong, M. Caverley, Y. Wang, L. Chrostowski, S. LaRochelle, D. Plant, and W. Shi, "Analytical modeling of silicon microring and microdisk modulators with electrical and optical dynamics" J Lightwave Technol. 33, PP. 4240-4252, 2015.

[10] Jong-Bum You, Miran Park, Jeong-Woo Park and Gyungock Kim, "12.5 Gbps optical modulation of silicon racetrack resonator based on carrier-depletion in asymmetric p-n diode", Opt. Exp, Vol. 16, No. 22, 2008.

[11] M. Pantouvaki, H. Yu, M. Rakowski, Ph. Christie, P. Verheyen, G. Lepage, N. Hoovels, Ph. Absil and J.V. Campenhout, IEEE J. Quantum Electron, "Comparison of Silicon Ring Modulators With Interdigitated and Lateral p-n Junctions", Vol. 19, NO. 2, 2013.

## زیرنویس‌ها

<sup>1</sup> Complementary Metal-Oxide Semiconductor

<sup>2</sup> Soref and Bennett

<sup>3</sup> Ring Resonator Modulator (RRM)

<sup>4</sup> Through

<sup>5</sup> Modulation Efficiency

<sup>6</sup> Insertion Loss

<sup>7</sup> Trade Off